



(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 209136246 U

(45)授权公告日 2019.07.23

(21)申请号 201721768035.5

(22)申请日 2017.12.13

(66)本国优先权数据

201721076029.3 2017.08.25 CN

(73)专利权人 贺运香

地址 528329 广东省佛山市顺德区均安镇
南浦东头二街1号

(72)发明人 贺运香

(74)专利代理机构 广东翰锐律师事务所 44442

代理人 陈业胜 杜锴健

(51)Int.Cl.

A47J 36/06(2006.01)

A47J 36/00(2006.01)

A47J 27/00(2006.01)

(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利

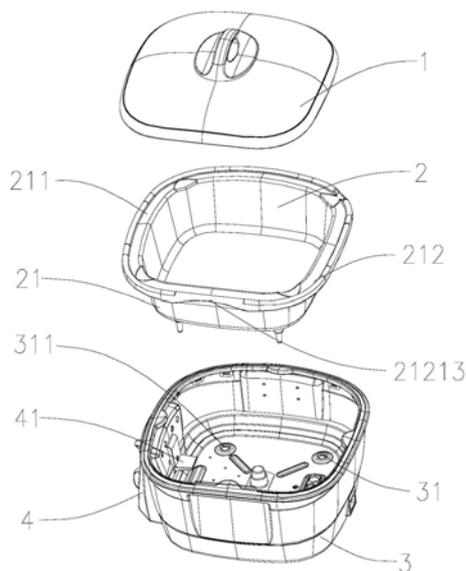
权利要求书1页 说明书7页 附图4页

(54)实用新型名称

一种锅体加热式烹调器

(57)摘要

本实用新型公开了一种锅体加热式烹调器，包括锅盖、锅体、底座和调控结构，所述锅体四边环壁构成方形结构，包括容置腔和由容置腔边沿延伸而出的锅沿，所述锅体上还设有环锅沿的台阶状外沿；所述锅盖与所述锅沿相配合，并盖合于所述锅沿上；外沿包括内圈，内圈由所述锅沿外端向上延伸而成，内圈顶端向外延伸出顶边，顶边外端向下延伸形成外圈；顶边连续三边为薄边，薄边所在外沿下表面为凹槽；顶边另一边为厚边，厚边下表面与锅沿下表面平齐设置；厚边下表面与薄边下表面由一斜坡衔接；通过巧妙设置厚边和斜坡结构，使得锅体锅沿的外沿在保持现有设计中凹槽结构带来的节省材料作用的同时，还达到凹槽内水分污物不易积累和易于人工清洗的效果。



1. 一种锅体加热式烹调器,包括锅盖、锅体、底座和调控结构,所述锅体设置于所述底座内;所述锅体四边环壁构成方形结构,包括容置腔和由容置腔边沿延伸而出的锅沿,所述锅体上还设有环绕锅沿的台阶状外沿;所述锅盖与所述锅沿相配合,并盖合于所述锅沿上;其特征在于,

所述外沿包括内圈,所述内圈由所述锅沿外端向上延伸而成,所述内圈顶端向外延伸出顶边,所述顶边外端向下延伸形成外圈;

所述顶边连续三边为薄边,所述薄边所在外沿下表面为凹槽;所述顶边另一边为厚边,所述厚边下表面与所述锅沿下表面平齐设置;所述厚边下表面与所述薄边下表面由一斜坡衔接。

2. 根据权利要求1所述的锅体加热式烹调器,其特征在于,所述锅盖与所述外沿内圈相抵靠,将锅盖水平方向上的位置限定。

3. 根据权利要求1所述的锅体加热式烹调器,其特征在于,所述锅体大小与所述底座相匹配,所述底座与所述锅体外侧相抵靠。

4. 根据权利要求1所述的锅体加热式烹调器,其特征在于,所述外圈宽度大于所述内圈的宽度,所述外圈下边沿超过所述锅沿的下表面。

5. 根据权利要求1所述的锅体加热式烹调器,其特征在于,所述厚边相邻两侧的凹槽设有提手槽,与所述提手槽相对应的外圈设有弧边。

6. 根据权利要求1所述的锅体加热式烹调器,其特征在于,所述调控结构上还设有探温部,所述探温部通过弹性件与调控结构相连;所述锅体设有厚边的一侧设有探温凸块,所述探温凸块与所述探温部可弹性地相互接触。

7. 根据权利要求6所述的锅体加热式烹调器,其特征在于,所述调控结构设置在所述底座侧壁上,并正对于所述锅体设有厚边的一侧。

8. 根据权利要求7所述的锅体加热式烹调器,其特征在于,还设有定位结构,所述定位结构包括设于锅体底部的多个对称分布的定位柱和设于底座上的多个定位孔,所述定位柱配合插接于所述定位孔内。

9. 根据权利要求8所述的锅体加热式烹调器,其特征在于,所述定位柱包括至少一个防呆柱,所述防呆柱偏离对称位设置;所述定位孔设有与所述防呆柱位置对应的防呆孔。

一种锅体加热式烹调器

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种厨房烹调器具,尤其是一种锅体加热式烹调器。

背景技术

[0002] 在日常生活中,经常需要用到插电烹调包含锅盖和烹调锅的烹调器具,许多烹调锅在锅沿上设有一圈环形的外沿用于固定锅盖的位置等,但是如图1所示,现有技术中有的外沿为由烹调锅向上形变而成,从锅沿的下表面看为开口向下的环形全通凹槽,全通的凹槽可以节省原材料用量,但是在用水清洗烹调锅之后在凹槽内容易积水,且凹槽的宽度较窄,这些积水在凹槽内由于水的表面张力不易流动,即使将烹调锅翻转凹槽开口向下也不易排出;除不易自然排出外,由于凹槽宽度较窄,也不便于人工再使用干布等伸入擦干。因此,当烹调锅重新摆放在底座上时,凹槽与底座壁接触,底座壁为凹槽内积水起到了导流的作用,积水易沿着底座壁流至底座壁上安装的开关调节结构上,水流进开关调节结构内易引起电器元件生锈损坏,甚至短路造成安全隐患。而且凹槽结构容易在使用过程中藏污纳垢,很难清洗与移除,长此以往,积累的水与污垢给细菌和霉菌等提供了良好的生长环境,生长的细菌和霉菌等若进入到锅体内部,污染食物会影响人体身体健康。

实用新型内容

[0003] 本实用新型目的在于提供一种锅体加热式烹调器,其锅体锅沿的外沿在保持现有设计中凹槽结构带来的节省材料作用的同时,还达到凹槽内水分污物不易积累和易于人工清洗的效果。

[0004] 为了达到上述目的,本实用新型的技术方案有:

[0005] 一种锅体加热式烹调器,包括锅盖、锅体、底座和调控结构,所述锅体设置于所述底座内;所述锅体四边环壁构成方形结构,包括容置腔和由容置腔边沿延伸而出的锅沿,所述锅体上还设有环锅沿的台阶状外沿;所述锅盖与所述锅沿相配合,并盖合于所述锅沿上;

[0006] 所述外沿包括内圈,所述内圈由所述锅沿外端向上延伸而成,所述内圈顶端向外延伸出顶边,所述顶边外端向下延伸形成外圈;

[0007] 所述顶边连续三边为薄边,所述薄边所在外沿下表面为凹槽;所述顶边另一边为厚边,所述厚边下表面与所述锅沿下表面平齐设置;所述厚边下表面与所述薄边下表面由一斜坡衔接。

[0008] 在使用和观察日常生活中现有的带有锅体的电加热烹调器的过程中,发明人发现,电加热烹调器有两种,一种是锅盖连接在底座上,盖合时主要靠底座支撑;另一种是锅盖与底座为分离状态,盖合时主要靠锅体支撑。在第二种烹调器中,为了支撑位于锅体上方的锅盖,需要在锅体的上边缘设置具有一定宽度的锅沿,锅盖放置在锅沿上。但是当锅盖放置在锅沿上时,需要认真对齐锅体的腔口,才可以使锅盖与锅体很好的盖合;而且在使用过程中,若需要移动锅体或者无意中碰撞锅盖,锅盖容易因为没有阻挡而从锅体上掉落摔碎,甚至会造成安全事故。因此,现有技术中采取在锅沿上设置固定结构(如:环锅沿的外沿)来

将锅盖固定在内,因此,盖合时可以快速对位,而且移动时也不易掉落摔碎,成为这种烹调器锅沿上必不可少的结构之一。在制造外沿时,很多生产者为了节省材料和降低制造难度,将已成型外沿的下表面的材料去除掉一部分,使得其呈现出开口向下的全通凹槽结构,仅在上表面保持凸出的形状用于定位。

[0009] 但是发明人发现:在清洗这种锅体时,由于凹槽宽度较窄,一旦在清洗和使用过程中有积水进入,由于水的表面张力的作用,即使凹槽的开口方向为向下,水也很难自动流出,若使用厨房常用的清洗工具(如抹布),也很难伸进凹槽内部擦洗;而且凹槽结构容易在使用过程中藏污纳垢,很难清洗与移除。长此以往,积累的水与污垢给细菌和霉菌等提供了良好的生长环境,生长的细菌和霉菌等若进入到锅体内部污染食物会影响人体身体健康,并产生难闻的气味,严重破坏了使用此锅体烹煮食物时的香味与影响了使用者的食欲。针对此问题,发明人希望在保持现有设计中凹槽结构带来的节省材料作用的同时,还达到凹槽内水分污物不易积累和易于人工清洗的效果。

[0010] 此外,发明人还发现:若想凹槽内的积水容易流走,需要相应的导流结构,若导流结构设置在烹调器的其他结构上,会给烹调锅其他部分增加结构,可能会影响美观或者增加制造难度等;若借助外部的工具用于导流,无法很好的随时跟着烹调器移动,每次使用时需要人工从别处再找寻工具来进行操作,造成额外的劳动,操作变复杂,人性化程度低。

[0011] 最后,发明人想到改变锅体本身的结构,来使得外沿下表面的凹槽变得积水容易流出,经过多次试验以后发现了合适的结构——将构成凹槽的一部分顶边设置为厚边,并且厚边下表面至顶边下表面由一斜坡衔接。此结构起到的有益效果很明显:一方面,当水分积累在凹槽内时,仅需稍微向厚边倾斜,斜坡即可起到导流棒的作用,使得水分容易的就从凹槽内流出,并沿斜坡流至厚边表面;而由于厚边的表面设置为与锅沿的下表面平齐,流至厚边表面的积水即相当于已流至面积很大的锅沿下表面,这时,使用抹布等,即可轻松的将积水擦除。另一方面,当有固体或非牛顿体的污物积累在凹槽内时,由于黏度较大,较难流动,直接使用工具推动污物一般只能使得污物在凹槽内移动却很难将污物带出,当凹槽内设有带斜坡的厚边时,可以使用工具将污物推动至斜坡再进一步推动至厚边与锅沿下表面的大平面上,进而可以容易地将污物去除。此种厚边与斜坡结合的方式,结构简单,制造方便,只需在原有的制作锅体成型模具时稍作改动即可生产,在铸造成型时,设有厚边的边无凹槽,没有复杂的型面,可以将锅体设有厚边的一面当做注料口,成型更加简单快速,而且整个侧直边的进料口进料面积大,成型速度快。可以最大程度上节省原材料,且保证了外沿凹槽内积水和积垢容易去除和清洗的效果。而由锅沿弯曲延伸形成的外沿,可以一体成型出所需的凹槽与厚边状结构,而且也可以方便地使得外沿与锅沿之间形成圆形倒角圆滑过渡,无需二次打磨,圆形的倒角结构可以减缓应力集中的程度,延长锅体使用的寿命。方形的锅体在整理收纳时比圆形锅体无论是摆放还是收纳都可以更好的契合一般柜体或灶台的直角,有效利用有限的厨房空间;而将整条边均设置为厚边,可以满足安装在此底座侧壁上的不同大小调控结构的防积水的要求。

[0012] 进一步地,所述锅盖与所述外沿内圈相抵靠,将锅盖水平方向上的位置限定。相对于一般的较宽松的锅盖限位结构而言,锅盖与用于限位的外延的内圈相抵靠,使得锅盖在水平方向上全方位的紧密限位,且杜绝了小范围内的滑动,使得锅盖的限位更加稳固,不易摔落。

[0013] 更进一步地,所述锅体大小与所述底座相匹配,所述底座与所述锅体外侧相抵靠。锅体与底座相匹配可以使得锅体与底座结合的更好,相互抵靠的结构可以锅体装配在底座内时,不会左右摇晃,形成异响。

[0014] 更进一步地,所述外圈宽度大于所述内圈的宽度,所述外圈下边沿超过所述锅沿的下表面。当锅体安装在底座上时,外圈的宽度大于内圈的宽度,外圈的下边沿比锅沿的下表面更低,使得外圈可以形成一个挡圈,可以挡住外界的杂物,尽量防止外界的杂物进入凹槽内。

[0015] 优选地,所述厚边相邻两侧的凹槽设有提手槽,与所述提手槽相对应的外圈设有弧边。一般而言,调控结构所在处即为烹调器的正面,而由于厚边所在侧与调控结构所在侧位置相对应,因此设有厚边的一侧也为锅体的正面,使用在使用时,一般是面对烹调器的正面来进行操作。那么,厚边相邻的两侧即为一般使用者使用两手提抬锅体时容易抓取的位置,因此,在此两侧设置提手槽更加利于一般的使用者操作,而外圈设置的弧边使得抓取更加容易,更符合人体工程学。

[0016] 进一步地,所述调控结构上还设有探温部,所述探温部通过弹性件与调控结构相连;所述锅体设有厚边的一侧设有探温凸块,所述探温凸块与所述探温部可弹性地接触。探温部用于通过探测探温凸块的温度来推测整个锅体的温度,而将探温部与调控结构相结合可以充分利用底座侧面的空间,减少了一般的探温部设置在锅体底部时所占用的底部空间,烹调器的整体结构更加紧凑,且可以避免底部发热装置对探测的温度产生影响;除了巧妙地利用了底座侧面空间之外,将探温部与探温凸块设置于设有厚边的一侧,既保证了调控结构免受积水积垢的影响,也使得探温部等免受积水积垢的影响,实现了空间与功能的良好结合。

[0017] 优选地,所述调控结构设置在所述底座侧壁上,并正对于所述锅体设有厚边的一侧。在将清洗完毕凹槽内有积水的锅体安装在底座上时,底座的侧壁与凹槽接触对凹槽内的积水起到导流的作用,积水流至底座壁上。而底座的侧壁有一处安装了调控结构,若积水沿底座的侧壁流至调控结构易引起调控结构短路造成安全隐患,厚边处不易积水,将厚边所在边与调控结构对应,防止了积水对调控结构造成的不良影响。

[0018] 优选地,还设有定位结构,所述定位结构包括设于锅体底部的多个对称分布的定位柱和设于底座上的多个定位孔,所述定位柱配合插接于所述定位孔内。定位结构使得锅体安装放置在底座上时更加稳定,定位柱插接入定位孔内,可以防止锅体各个角度方向上的晃动与位移,使用更加安全。

[0019] 进一步地,所述定位柱包括至少一个防呆柱,所述防呆柱偏离对称位设置;所述定位孔设有与防呆柱位置对应的防呆孔。在安装锅体至底座上时,需对齐定位柱与定位孔才可将锅体安装在底座上,若定位柱全部为对称设置,在安装锅体时容易将设有厚边的一侧安装至未设有调控结构的一侧,达不到防止调控结构进水的效果。若至少将一个防呆柱从对称位置偏离,形成一个不对称的定位柱排布,在安装锅体至底座上时,若锅体没有按预设的正确位置安装,防呆柱无法插接入一般的定位孔内,无法完成安装,达到防呆的效果。

[0020] 一种锅体加热式烹调器,包括锅盖、锅体、底座和调控结构,所述锅体四边环壁构成方形结构,包括容置腔和由容置腔边沿延伸而出的锅沿,所述锅体上还设有环锅沿的台阶状外沿;所述锅盖与所述锅沿相配合,并盖合于所述锅沿上;所述外沿包括内圈,所述内

圈由所述锅沿外端向上延伸而成,所述内圈顶端向外延伸出顶边,所述顶边外端向下延伸形成外圈;所述顶边连续三边为薄边,所述薄边所在外沿下表面为凹槽;所述顶边另一边为厚边,所述厚边下表面与所述锅沿下表面平齐设置;所述厚边下表面与所述薄边下表面由一斜坡衔接。通过巧妙设置厚边和斜坡结构,使得锅体锅沿的外沿在保持现有设计中凹槽结构带来的节省材料作用的同时,还达到凹槽内水分污物不易积累和易于人工清洗的效果。

附图说明

- [0021] 图1为现有技术中的一种外沿带有全通凹槽锅体的剖视图;
- [0022] 图2为本实用新型中的一种锅体加热式烹调器的爆炸图;
- [0023] 图3为本实用新型中的一种锅体加热式烹调器的锅体的仰视图;
- [0024] 图4为本实用新型中的一种锅体加热式烹调器的锅体的剖视图;
- [0025] 图5为图4中A处的放大图;
- [0026] 图6为图4中B处的放大图;
- [0027] 图7为本实用新型中的一种锅体加热式烹调器的剖视图;
- [0028] 图8为本实用新型中锅体与调控结构的爆炸图。

具体实施方式

[0029] 结合附图说明本实用新型的一种锅体加热式烹调器:

[0030] 如附图2-8所示:

[0031] 一种锅体2加热式烹调器,包括锅盖1、锅体2、底座3和调控结构4,所述锅体2设置于所述底座3内;所述锅体2四边环壁构成方形结构,包括容置腔21和由容置腔21边沿延伸而出的锅沿211,所述锅体2上还设有环锅沿211的台阶状外沿212;所述锅盖1与所述锅沿211相配合,并盖合于所述锅沿211上;

[0032] 所述外沿212包括内圈2123,所述内圈2123由所述锅沿211外端向上延伸而成,所述内圈2123顶端向外延伸出顶边2124,所述顶边2124外端向下延伸形成外圈2125;

[0033] 所述顶边2124连续三边为薄边21214,所述薄边21214所在外沿下表面为凹槽2121;所述顶边2124另一边为厚边21211,所述厚边21211下表面与所述锅沿211下表面平齐设置;所述厚边21211下表面与所述薄边21214下表面由一斜坡21212衔接。

[0034] 在使用和观察日常生活中现有的带有锅体2的电加热烹调器的过程中,发明人发现,电加热烹调器有两种,一种是锅盖1连接在底座3上,盖合时主要靠底座3支撑;另一种是锅盖1与底座3为分离状态,盖合时主要靠锅体2支撑。在第二种烹调器中,为了支撑位于锅体2上方的锅盖1,需要在锅体2的上边缘设置具有一定宽度的锅沿211,锅盖1放置在锅沿211上。但是当锅盖1放置在锅沿211上时,需要认真对齐锅体2的腔口,才可以使锅盖1与锅体2很好的盖合;而且在使用过程中,若需要移动锅体2或者无意中碰撞锅盖1,锅盖1容易因为没有阻挡而从锅体2上掉落摔碎,甚至会造成安全事故。因此,现有技术中采取在锅沿211上设置固定结构(如:环锅沿211的外沿212)来将锅盖1固定在内,因此,盖合时可以快速对位,而且移动时也不易掉落摔碎,成为这种烹调器锅沿211上必不可少的结构之一。

[0035] 如附图1所示:

[0036] 在制造外沿212时,很多生产者为了节省材料和降低制造难度,将已成型外沿212的下表面的材料去除掉一部分,使得其呈现出开口方向为向下的全通凹槽24结构,仅在上表面保持凸出的形状用于定位。

[0037] 但是发明人发现:在清洗这种锅体2时,由于凹槽2121宽度较窄,一旦在清洗和使用过程中有积水进入,由于水的表面张力的作用,即使凹槽2121的开口为向下设置,水也很难自动流出,若使用厨房常用的清洗工具(如抹布),也很难伸进凹槽2121内部擦洗;而且凹槽2121结构容易在使用过程中藏污纳垢,很难清洗与移除。长此以往,积累的水与污垢给细菌和霉菌等提供了良好的生长环境,生长的细菌和霉菌等若进入到锅体2内部污染食物会影响人体身体健康,并产生难闻的气味,严重破坏了使用此锅体2烹煮食物时的香味与影响了使用者的食欲。针对此问题,发明人希望在保持现有设计中凹槽2121结构带来的节省材料作用的同时,还达到凹槽2121内水分污物不易积累和易于人工清洗的效果。

[0038] 此外,发明人还发现:若想凹槽2121内的积水容易流走,需要相应的导流结构,若导流结构设置在烹调器的其他结构上,会给烹调锅其他部分增加结构,可能会影响美观或者增加制造难度等;若借助外部的工具用于导流,无法很好的随时跟着烹调器移动,每次使用时需要人工从别处再找寻工具来进行操作,造成额外的劳动,操作变复杂,人性化程度低。

[0039] 如附图3-6所示:

[0040] 最后,发明人想到改变锅体2本身的结构,来使得外沿212下表面的凹槽2121变得积水容易流出,经过多次试验以后发现了合适的结构——将构成凹槽2121的一部分顶边2124设置为厚边21211,并且厚边21211表面至顶边2124下表面由一斜坡21212衔接;顶边2124的其余三面设置为薄边21214,使得原有的凹槽结构得到保持。此结构起到的有益效果很明显:一方面,当水分积累在凹槽2121内时,仅需稍微向厚边21211倾斜,斜坡21212即可起到导流棒的作用,使得水分容易的就从凹槽2121内流出,并沿斜坡21212流至厚边21211表面;而由于厚边21211的表面设置为与锅沿211的下表面平齐,流至厚边21211表面的积水即相当于已流至面积很大的锅沿211下表面,这时,使用抹布等,即可轻松的将积水擦除。另一方面,当有固体或非牛顿体的污物积累在凹槽2121内时,由于黏度较大,较难流动,直接使用工具推动污物一般只能使得污物在凹槽2121内移动却很难将污物带出,当凹槽2121内设有带斜坡21212的厚边21211时,可以使用工具将污物推动至斜坡21212再进一步推动至厚边21211与锅沿211下表面的大平面上,进而可以容易地将污物去除。此种厚边21211与斜坡21212结合的方式,结构简单,制造方便,只需在原有的制作锅体2成型模具时稍作改动即可生产,在铸造成型时,设有厚边21211的边无凹槽,没有复杂的型面,可以将锅体2设有厚边21211的一面当做注料口,成型更加简单快速,而且整个侧直边的进料口进料面积大,成型速度快。可以最大程度上节省原材料,且保证了外沿212凹槽2121内积水和积垢容易去除和清洗的效果。由锅沿211弯曲延伸形成的外沿212,可以一体成型出所需的凹槽2121与厚边21211状结构,而且也可以方便地使得外沿212与锅沿211之间形成圆形倒角圆滑过渡,无需二次打磨,圆形的倒角结构可以减缓应力集中的程度,延长锅体2使用的寿命。方形的锅体2在整理收纳时比圆形锅体2无论是摆放还是收纳都可以更好的契合一般柜体或灶台的直角,有效利用有限的厨房空间;而将整条边均设置为厚边21211,可以满足安装在此底座3侧壁上的不同大小调控结构4的防积水的要求。

[0041] 进一步地,所述外沿212包括内圈2123,所述内圈2123由所述锅沿211外端向上延伸而成,所述内圈2123顶端向外延伸出顶边2124,所述顶边2124外端向下延伸形成外圈2125。由锅沿211弯曲延伸形成的外沿212,可以一体成型出所需的凹槽2121与厚边21211状结构,而且也可以方便地使得外沿212与锅沿211之间形成圆形倒角圆滑过渡,无需二次打磨,圆形的倒角结构可以减缓应力集中的程度,延长锅体2使用的寿命。

[0042] 如附图7所示:

[0043] 更进一步地,所述锅盖1与所述外沿212内圈2123相抵靠,将锅盖1水平方向上的位置限定。相对于一般的较宽松的锅盖1限位结构而言,锅盖1与用于限位的外延的内圈2123相抵靠,使得锅盖1在水平方向上全方位的紧密限位,且杜绝了小范围内的滑动,使得锅盖1的限位更加稳固,不易摔落。

[0044] 更进一步地,所述锅体2大小与所述底座3相匹配,所述底座3与所述锅体2外侧相抵靠。锅体2与底座3相匹配可以使得锅体2与底座3结合的更好,相互抵靠的结构可以锅体2在装配在底座3内时,不会左右摇晃,形成异响。

[0045] 更进一步地,所述外圈2125宽度大于所述内圈2123的宽度,所述外圈2125下边沿超过外圈2125的下边沿比锅沿211的下表面更低,使得所述锅沿211的下表面。当锅体2安装在底座3上时,外圈2125的宽度大于内圈2123的宽度,外圈2125可以形成一个挡圈,可以挡住外界的杂物,尽量防止外界的杂物进入凹槽2121内。

[0046] 如附图2所示:

[0047] 优选地,所述厚边21211相邻两侧的凹槽2121设有提手槽21213,与所述提手槽21213相对应的外圈2125设有弧边。一般而言,调控结构4所在处即为烹调器的正面,而由于厚边21211所在侧与调控结构4所在侧位置相对应,因此设有厚边21211的一侧也为锅体2的正面,使用在使用时,一般是面对烹调器的正面来进行操作。那么,厚边21211相邻的两侧即为一般使用者使用两手提抬锅体时容易抓取的位置,因此,在此两侧设置提手槽21213更加利于一般的使用者操作,而外圈2125设置的弧边使得抓取更加容易,更符合人体工程学。

[0048] 如附图7-8所示:

[0049] 进一步地,所述调控结构4上还设有探温部41,所述探温部41通过弹性件42与调控结构4相连;所述锅体2设有厚边21211的一侧设有探温凸块23,所述探温凸块23与所述探温部41可弹性地接触。探温部41用于通过探测探温凸块23的温度来推测整个锅体的温度,而将探温部41与调控结构4相结合可以充分利用底座3侧面的空间,减少了一般的探温部41设置在锅体2底部时所占用的底部空间,烹调器的整体结构更加紧凑,且可以避免底部发热装置对探测的温度产生影响;除了巧妙地利用了底座侧面空间之外,将探温部41与探温凸块23设置于设有厚边21211的一侧,既保证了调控结构4免受积水积垢的影响,也使得探温部41等免受积水积垢的影响,实现了空间与功能的良好结合。

[0050] 优选地,所述调控结构4设置在所述底座3侧壁上,并正对于所述锅体2设有厚边21211的一侧。在将清洗完毕凹槽2121内有积水的锅体2安装在底座3上时,底座3的侧壁与凹槽2121接触对凹槽2121内的积水起到导流的作用,积水流至底座3壁上。而底座3的侧壁有一处安装了调控结构4,若积水沿底座3的侧壁流至调控结构4易引起调控结构4短路造成安全隐患,厚边21211处不易积水,将厚边21211所在边与调控结构4对应,防止了积水对调控结构4造成的不良影响。

[0051] 如附图2-3所示:

[0052] 优选地,还设有定位结构,所述定位结构包括设于锅体2底部的多个对称分布的定位柱23和设于底座3上的多个定位孔31,所述定位柱23配合插接入所述定位孔31内。定位结构使得锅体2安装放置在底座3上时更加稳定,定位柱23插接入定位孔31内,可以防止锅体2各个角度方向上的晃动与位移,使用更加安全。

[0053] 进一步地,所述定位柱23包括至少一个防呆柱231,所述防呆柱231偏离对称位设置;所述定位孔31设有与防呆柱231位置对应的防呆孔311。在安装锅体2至底座3上时,需对齐定位柱23与定位孔311才可将锅体2安装在底座3上,若定位柱23全部为对称设置,在安装锅体2时容易将设有厚边21211的一侧安装至未设有调控结构4的一侧,达不到防止调控结构4进水的效果。若至少将一个防呆柱231从对称位置偏离,形成一个不对称的定位柱23排布,在安装锅体2至底座3上时,若锅体2没有按预设的正确位置安装,防呆柱231无法插接入一般的定位孔311内,无法完成安装,达到防呆的效果。

[0054] 一种锅体2加热式烹调器,包括锅盖1、锅体2、底座3和调控结构4,所述锅体2四边环壁构成方形结构,包括容置腔21和由容置腔21边沿延伸而出的锅沿211,所述锅体2上还设有环锅沿211的台阶状外沿212;所述锅盖1与所述锅沿211相配合,并盖合于所述锅沿211上;所述外沿212包括内圈2123,所述内圈2123由所述锅沿211外端向上延伸而成,所述内圈2123顶端向外延伸出顶边2124,所述顶边2124外端向下延伸形成外圈2125;所述顶边2124连续三边为薄边21214,所述薄边21214所在外沿下表面为凹槽2121;所述顶边2124另一边为厚边21211,所述厚边21211下表面与所述锅沿211下表面平齐设置;所述厚边21211下表面与所述薄边21214下表面由一斜坡21212衔接。通过巧妙设置厚边21211和斜坡21212结构,使得锅体2锅沿211的外沿212在保持现有设计中凹槽2121结构带来的节省材料作用的同时,还达到凹槽2121内水分污物不易积累和易于人工清洗的效果。

[0055] 根据上述说明书的揭示和教导,本实用新型所属领域的技术人员还可以对上述实施方式进行了变更和修改。因此,本实用新型并不局限于上面揭示和描述的具体实施方式,对本实用新型的一些修改和变更也应当落入本实用新型的权利要求的保护范围内。此外,尽管本说明书中使用了一些特定的术语,但这些术语只是为了方便说明,并不对本实用新型构成任何限制。

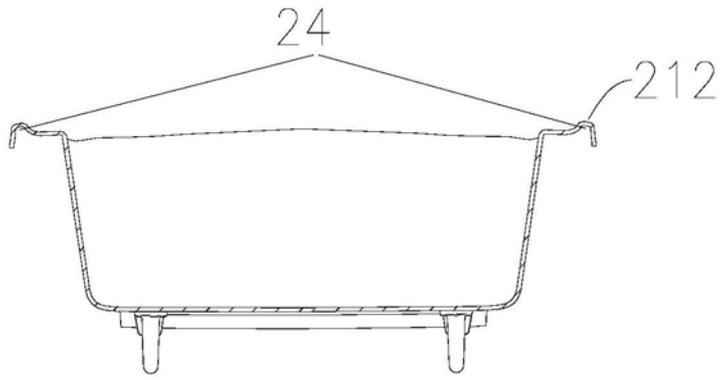


图1

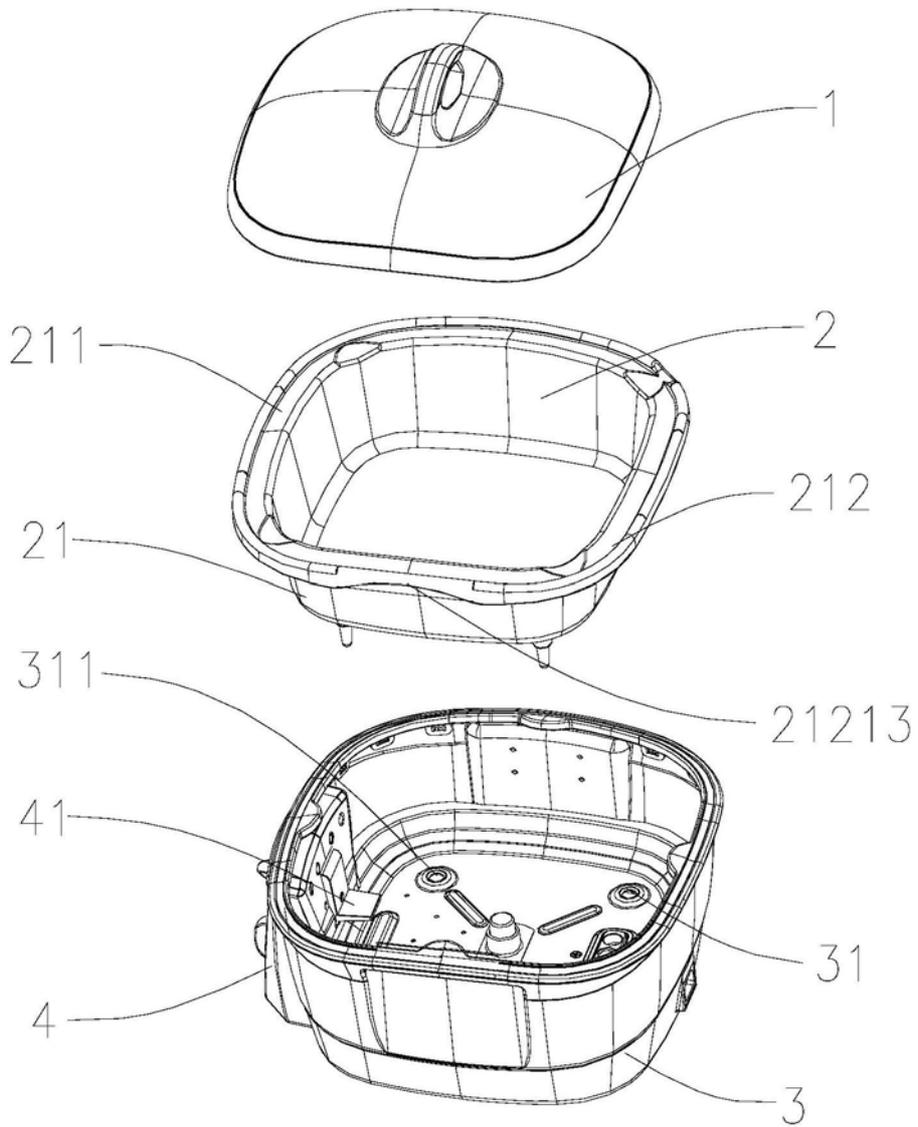


图2

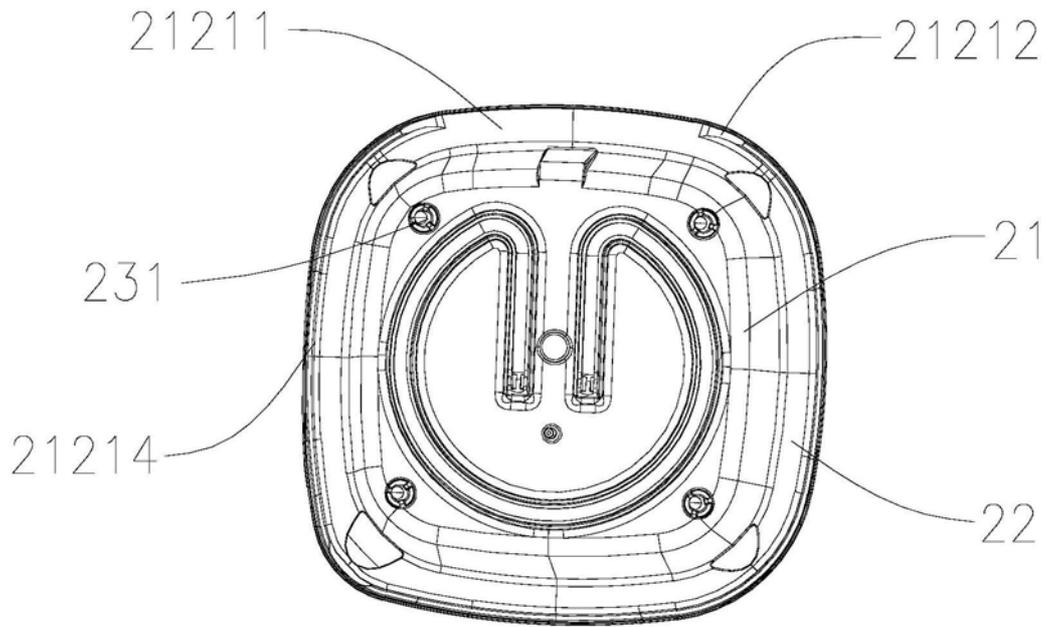


图3

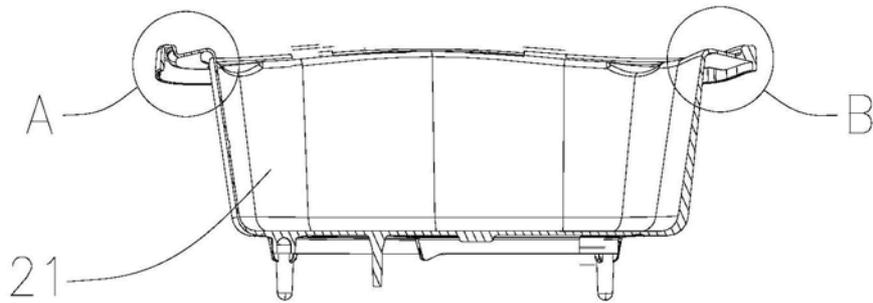


图4

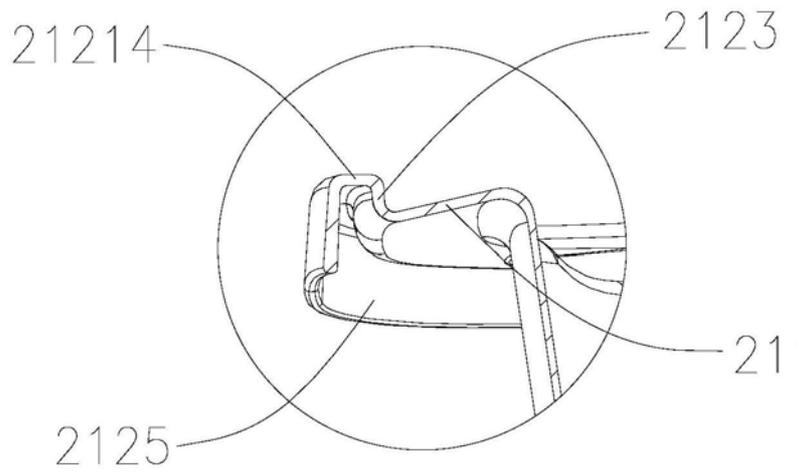


图5

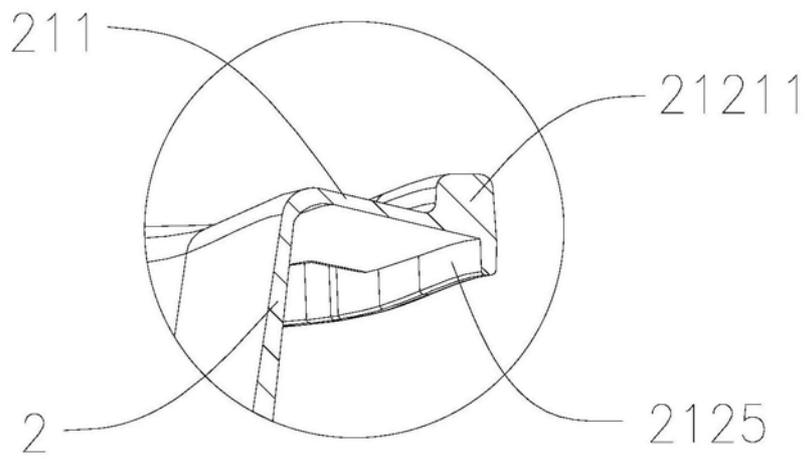


图6

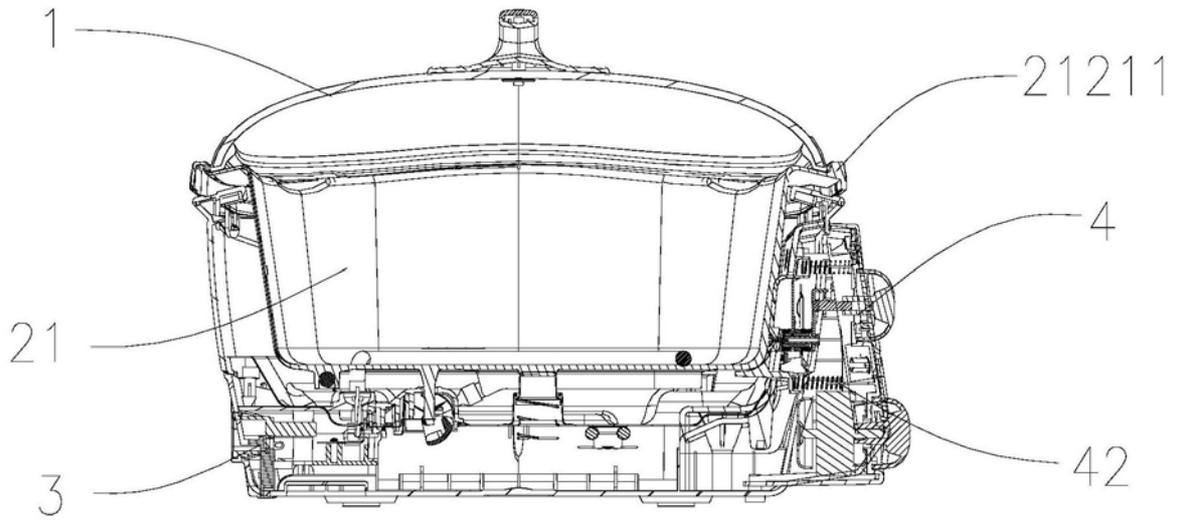


图7

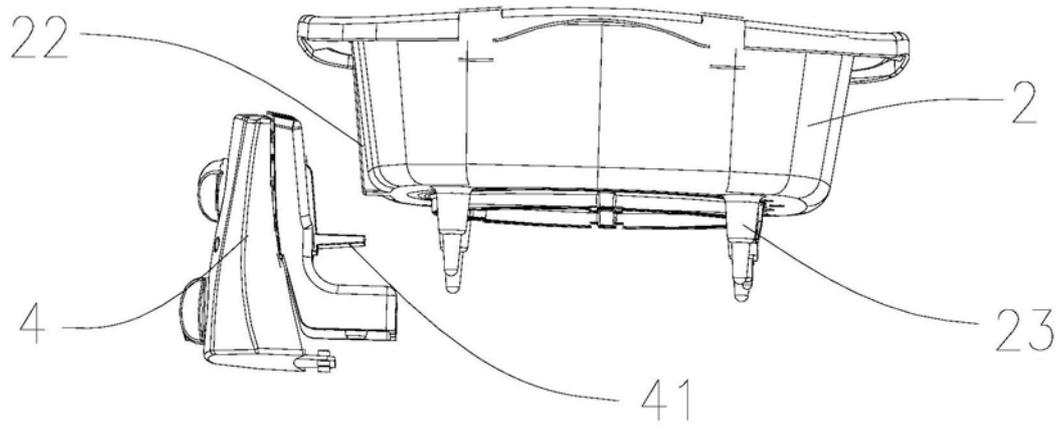


图8